

(12)

Recherchenbericht

(Österreichische Patentanmeldung)

(21) Anmeldenummer:	A 9286/2018	(51) Int. Cl.:	B22F 3/12	(2006.01)
(86) PCT-Anmeldenummer:	PCT/JP18033273		B22F 3/15	(2006.01)
(22) Anmeldetag:	07.09.2018		B22F 3/18	(2006.01)
(88) Recherchenbericht			C22C 1/04	(2006.01)
veröffentlicht am:	15.10.2021		C22C 27/04	(2006.01)
			C23C 14/14	(2006.01)
			C23C 14/34	(2006.01)

(30) Priorität:
10.11.2017 JP 2017217737 beansprucht.

(56) Entgegenhaltungen:
US 2015023837 A1
EP 2907891 A1
JP H0776771 A

(71) Patentanmelder:
JX NIPPON MINING & METALS
CORPORATION
100-8164 Tokio (JP)

(72) Erfinder:
Sogawa Shinji
3191535 (JP)
Dasai Takafumi
3191535 (JP)
Nakasumi Seiji
3191535 (JP)

(74) Vertreter:
SONN Patentanwälte OG
1010 Wien (AT)

(54) **Wolfram-Sputtering-Target und Verfahren zu seiner Herstellung**

(57) Ein Wolfram-Sputtering-Target wird vorgesehen, das in der Lage ist, einen Wolframfilm mit einem geringen spezifischen Widerstand zu bilden, wenn der Wolframfilm unter Verwendung des Wolfram-Sputtering-Targets gebildet wird. Ein Wolfram-Sputtering-Target, wobei eine Reinheit von Wolfram 5 N (99,999 Gew.-%) oder mehr beträgt, und eine Verunreinigung von Kohlenstoff und eine Verunreinigung von Sauerstoff, die im Wolfram enthalten sind, jeweils 50 ppm, bezogen auf das Gewicht, oder weniger betragen, und eine mittlere Wolframkristall-Korngröße mehr als 100 µm beträgt.

Klassifikation des Anmeldegegenstands gemäß IPC: B22F 3/12 (2006.01); B22F 3/15 (2006.01); B22F 3/18 (2006.01); C22C 1/04 (2006.01); C22C 27/04 (2006.01); C23C 14/14 (2006.01); C23C 14/34 (2006.01)
Klassifikation des Anmeldegegenstands gemäß CPC: B22F 3/12 (2013.01); B22F 3/15 (2013.01); B22F 3/18 (2013.01); C22C 1/045 (2013.01); C22C 27/04 (2013.01); C23C 14/14 (2013.01); C23C 14/3414 (2013.01)
Recherchierter Prüfstoff (Klassifikation): B22F, C22C, C23C
Konsultierte Online-Datenbank: EPODOC, WPI, Volltext-Patentdatenbanken EN und DE
Dieser Recherchenbericht wurde zu den am 07.09.2018 eingereichten Ansprüchen 1 - 6 erstellt.

Kategorie ^{*)}	Bezeichnung der Veröffentlichung: Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich	Betreffend Anspruch
X	US 2015023837 A1 (OHASHI KAZUMASA [JP], OKABE TAKEO [JP]) 22. Januar 2015 (22.01.2015) Beschreibung, [0064] - [0066],	1
A	Beschreibung, [0057] - [0060], [0064] - [0066], [0070] - [0072]	4
X	EP 2907891 A1 (JX NIPPON MINING & METALS CORP [JP]) 19. August 2015 (19.08.2015) Beschreibung, [0017], [0039] - [0046], Tab.1	1
A	Beschreibung, [0017], [0039] - [0046]	4
A	JP H0776771 A (JAPAN ENERGY CORP) 20. März 1995 (20.03.1995) (automatische Übersetzung durch TXPMTJEA / EPO am 17.09.2021) Beschreibung, [0007] - [0009], [0013] - [0015]; 1, 2, 4, 5	1 - 6

Datum der Beendigung der Recherche: 20.09.2021	Seite 1 von 1	Prüfer(in): AIGNER Martin
---	---------------	------------------------------

^{*)} Kategorien der angeführten Dokumente: X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung : der Anmeldegegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden. Y Veröffentlichung von Bedeutung : der Anmeldegegenstand kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist.	A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert. P Dokument, das von Bedeutung ist (Kategorien X oder Y), jedoch nach dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurde. E Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie X), aus dem ein „ älteres Recht “ hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage stellen). & Veröffentlichung, die Mitglied der selben Patentfamilie ist.
---	---